

## 特許協力条約

REC'D 22 MAR 2006

PCT

WIPO

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

(法第 12 条、法施行規則第 56 条)  
[PCT36 条及び PCT 規則 70]

出願人又は代理人 の書類記号 P05-36	今後の手続きについては、様式 PCT/IPEA/416 を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2005/003214	国際出願日 (日.月.年) 25. 02. 2005	優先日 (日.月.年) 25. 02. 2004
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. G02B6/12 (2006.01), G02B6/13 (2006.01), C08F299/00 (2006.01), G03F7/004 (2006.01), G03F7/033 (2006.01)		
出願人 (氏名又は名称) 関西ペイント株式会社		

1. この報告書は、PCT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。  
法施行規則第 57 条 (PCT36 条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a.  附属書類は全部で 1 ページである。

補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙 (PCT 規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)

第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b.  電子媒体は全部で \_\_\_\_\_ (電子媒体の種類、数を示す)。  
配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。  
(実施細則第 802 号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

第 I 欄 国際予備審査報告の基礎  
 第 II 欄 優先権  
 第 III 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成  
 第 IV 欄 発明の單一性の欠如  
 第 V 欄 PCT35 条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明  
 第 VI 欄 ある種の引用文献  
 第 VII 欄 国際出願の不備  
 第 VIII 欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 28. 11. 2005	国際予備審査報告を作成した日 14. 03. 2006
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	特許庁審査官 (権限のある職員) ▲高▼芳徳 電話番号 03-3581-1101 内線 3294
	2X 9813

## 第I欄 報告の基礎

1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。

出願時の言語による国際出願  
 出願時の言語から次の目的のための言語である \_\_\_\_\_ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文  
 国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))  
 国際公開 (PCT規則12.4(a))  
 国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条 (PCT第14条) の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

出願時の国際出願書類

明細書

第 1-24 ページ、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、\_\_\_\_\_ 付きで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、\_\_\_\_\_ 付きで国際予備審査機関が受理したもの

請求の範囲

第 2-5 項、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、PCT第19条の規定に基づき補正されたもの  
 第 1 項\*、23.02.2006 付きで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、\_\_\_\_\_ 付きで国際予備審査機関が受理したもの

図面

第 \_\_\_\_\_ ページ／図、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ／図\*、\_\_\_\_\_ 付きで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ／図\*、\_\_\_\_\_ 付きで国際予備審査機関が受理したもの

配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3.  補正により、下記の書類が削除された。

<input type="checkbox"/> 明細書	第 _____	ページ
<input type="checkbox"/> 請求の範囲	第 _____	項
<input type="checkbox"/> 図面	第 _____	ページ／図
<input type="checkbox"/> 配列表 (具体的に記載すること)	_____	
<input type="checkbox"/> 配列表に関するテーブル (具体的に記載すること)	_____	

4.  この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかつたものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

<input type="checkbox"/> 明細書	第 _____	ページ
<input type="checkbox"/> 請求の範囲	第 _____	項
<input type="checkbox"/> 図面	第 _____	ページ／図
<input type="checkbox"/> 配列表 (具体的に記載すること)	_____	
<input type="checkbox"/> 配列表に関するテーブル (具体的に記載すること)	_____	

\* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1 - 5	有
	請求の範囲		無
進歩性 (I S)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1 - 5	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲	1 - 5	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1 : JP 2003-149475 A (日本化薬株式会社) 2003.05.21 段落【0006】-【0026】  
(ファミリーなし)

文献2 : JP 2003-43684 A (日本化薬株式会社) 2003.02.13 段落【0025】-【0026】 , 【0070】  
(ファミリーなし)

文献3 : JP 3-223759 A (関西ペイント株式会社) 1991.10.02 全文  
& EP 435262 A2 & US 5045434 A & KR 9401555 B & CA 2032630 A

文献4 : JP 11-288088 A (関西ペイント株式会社) 1999.10.19 全文  
& US 6093518 A & TW 476020 B

## 請求の範囲 1 - 5

請求の範囲 1 - 5 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1, 3, 4 と、新たに引用した文献2 とにより、進歩性を有さない。

文献1には、分子中に少なくとも1個のエチレン性不飽和基と少なくとも1個のカルボキシル基とを有するエチレン性不飽和基含有カルボン酸樹脂と、溶媒と、光ラジカル重合開始剤とを少なくとも含有してなる光導波路形成用光硬化性樹脂組成物、及び、それを用いた光導波路が記載されている。特に、文献1の【0022】 , 【0023】段落には、前記光導波路形成用光硬化性樹脂組成物に、必要に応じて、各種エポキシ樹脂を加えることが記載されている。

文献2には、光導波路形成用光感光性樹脂組成物に使用する任意成分としての硬化成分(H)として、エポキシ化合物が記載されている。前記硬化成分(H)は、光硬化後の樹脂塗膜に残存するカルボキシル基と加熱により反応し、さらに強固な硬化塗膜を得るために特に好ましく用いられる(【0025】段落)。そして、文献2の【0026】段落等には、そのようなエポキシ化合物として、ビスフェノール型エポキシ樹脂又はノボラック型エポキシ樹脂が記載されている。

文献2に開示された上記技術思想に基づき、文献1に記載の光導波路形成用光硬化性樹脂組成物に必要に応じて加えるエポキシ樹脂を、ビスフェノール型エポキシ樹脂又はノボラック型エポキシ樹脂とすることは、当業者にとって容易である。

請求の範囲1は製造方法によって物を特定しようとする請求項である。請求の範囲1と文献1とでカルボキシル基含有不飽和樹脂の製造方法は異なるが、結果として得られる請求の範囲1に記載のカルボキシル基含有不飽和樹脂(A)と、文献1におけるエチレン性不飽和基含有カルボン酸樹脂は同等であって、物として相違しない。尚、請求の範囲1に記載されたカルボキシル基含有不飽和樹脂(A)(文献1におけるエチレン性不飽和基含有カルボン酸樹脂がこれに該当する)の製造方法それ自体も、文献3又は4に記載されている。請求項3, 5に関して、光導波路形成用光硬化性樹脂組成物をドライフィルムに成形することは周知の技術である。

## 請求の範囲

## [1] (補正後)

カルボキシル基含有樹脂(a)とエポキシ基含有不飽和化合物(b)とを反応させて得られるカルボキシル基含有不飽和樹脂(A)、溶媒(B)、及び、ビスフェノール型エポキシ樹脂又はノボラック型エポキシ樹脂を含有してなる光導波路形成用光硬化性樹脂組成物。

[2] 更に、光ラジカル重合開始剤を含有する請求項1に記載の光導波路形成用光硬化性樹脂組成物。

[3] 請求項1に記載の光導波路形成用光硬化性樹脂組成物によって形成される光導波路形成用光硬化性ドライフィルム。

[4] 下部クラッド層(I)、コア部(II)及び上部クラッド層(III)で構成される光導波路であつて、これらの構成要素のうちの少なくとも1つが請求項1に記載の光導波路形成用光硬化性樹脂組成物で形成されてなる光導波路。

[5] 下部クラッド層(I)、コア部(II)及び上部クラッド層(III)で構成される光導波路であつて、これらの構成要素のうちの少なくとも1つが請求項3に記載の光導波路形成用光硬化性ドライフィルムで形成されてなる光導波路。